

平成25年

年頭所感



特許庁長官
深野 弘行

平成25年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

昨年12月に、生物のあらゆる細胞に成長でき、再生医療の実現や新薬開発につながるiPS細胞の分野で京都大学の山中教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されたことは、知財立国を進める我が国にとって誠に意義深いことであります。iPS細胞については、世界各国での特許の取得なども活発に行われており、先端技術の研究成果の活用を進め、社会還元する有効な手段として特許の意義が再認識されているところです。知的財産制度は、こうした研究開発活動を進める重要なインフラであるという認識を新たにいたしました。

近年の我が国企業の知的財産活動は、中小企業を含め多くの企業が事業の海外展開を進める中、急速に国際化が進んでおります。我が国出願人の海外への特許出願件数は世界でもトップクラスであり、特許出願がリーマンショックの影響を受けた2008年以来伸び悩む中で、国際出願は2011年でも前年2割増となるなど増勢が続いております。今や、財の貿易収支が入超となるなか、技術貿易収支は2011年に2兆円の黒字を記録、「技術で稼ぐ」構造が明確になりつつあります。今後、新興国の急速な追い上げの中、我が国企業の技術的優位を保ち、知的財産を活用して高くても売れる製品やサービスを生み出す価値創造モデルへの転換が求められています。

このような状況の下、特許、意匠、商標などの知的財産制度は、産業活動のインフラとして、ユーザーにとって使いやすい、高い信頼性を持つものであることが必要です。また、海外の知的財産庁と協力することにより、国内外を問わず、できるだけ迅速で確実な取得、活用ができる環境を作り出していくことが求められます。

このため、日本国特許庁では、日米欧の三極で情報技術の利用や制度運用の共通化などの面で協力を続け、協力は昨年で30周年を迎えました。更に、日、米、欧、韓、そ

れに近年知財大国化が進む中国を交えた五大特許庁会合において、特許制度調和や運用の改善を推進しています。日本との経済的な結びつきが強いアセアン諸国については、長官レベルで意見交換の場を設け、人材育成などの様々な協力について議論を行いました。本年4月には、日本において「第3回日アセアン特許庁長官会合」の開催が予定されています。

こうした多国間の協力に加え、新興国への我が国企業の進出活発化などを踏まえ、特許審査ハイウェイの設定や特許協力条約の枠組みを活用した審査結果の利用など、二国間協力を推進しております。シンガポールからは、同国が受理した特許協力条約に基づく国際出願（PCT出願）に対して国際調査を行う機関として日本国特許庁が指定されました。インドの間では、日本から専門家を派遣し、急増する出願に対応するために新規採用した審査官に対する研修を実施することになりました。またWIPOに日本から資金を拠出するなど、アジア、アフリカ諸国の審査官や知財関係者に対して研修を実施しており、受講者はこれまでで3730人に達しています。このように、中小企業を含む企業の幅広い海外展開の中で、日本国特許庁は事業活動の重要なインフラの一つとしての世界各国の知財制度整備にできる限りの貢献をしております。

我が国が知的財産権の利活用を進めていくためには、地域における知的財産についての理解と利用の増進を図らなければなりません。それぞれの地域では、中小企業が技術力や創意工夫により業界ナンバーワンのシェアを獲得する、国内市場が縮小傾向にある分野において海外展開を進め新たな需要に対応するなど様々な事業展開を行っております。こうした事業展開には特許、商標、意匠など知的財産権の活用戦略が関連してきます。特許庁ではそれぞれの地域の経済産業局に特許室を置くとともに、中小企業の知的財産活用の御相談に応じ、また支援する「知的財産総合支援窓口」を全国に設置しています。戦略的に外国出願を

行う地域中小企業に対し、費用の一部を助成する地域中小企業外国出願支援事業を実施しており、また、昨年4月には中小企業向けの特許料の減免拡充を行いました。今後も中小企業による知的財産権の取得・活用の支援に取り組んでまいります。

我が国には伝統文化や感性にはぐくまれた優れたデザインがあります。デザインを活用して、製品、サービスの付加価値を高め、顧客に対して強い訴求力を発揮するデザイン・ブランドの重要性も増しています。こうした流れの中で、意匠の保護、活用を強化するため、各国への出願手続を一括で行うことのできるハーグ協定ジュネーブアクトへの加盟や最近利用が進んでいるGUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）などへの画像デザインの保護拡充を含めて産業構造審議会において検討をいただいております。

商標についても、音、色など、商品の識別に活用される手段を新たな商標として追加するべく、現在産業構造審議会にて検討をいただいております。国際的には中国における商標登録出願件数が、2011年に年間142万件となり、第2位の米国の39.9万件を大きく引き離すなど、大きな変化が起こりつつあるなかで、日、米、欧、韓、中の商標五庁会合が初めて開催され、共同宣言が採択されました。日本国特許庁は、冒認商標問題に関する協力プロジェクトや図形商標の新たな検索手法の研究などをリードしていくこととしております。

特許庁は「知財推進計画2004」の中で「2013年に特許の審査順番待ち期間を11か月にする」という目標を掲げ取組を進めてまいりました。現在、審査順番待ち期間は20か月を下回っており、目標達成に向けて着実に進んでおります。今後もユーザーの皆様方の御要望に十分応えることができるよう、迅速かつ的確な審査を推進し、また、国際協調とワークシェアリングを進め、タイムリーな審査と信頼性の高い権利付与が実現できるよう努めてまいります。

本年も知的財産行政に対する倍旧の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。私の新年の御挨拶いたします。

